(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 17. Juni 2004 (17.06.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/050960 A1

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): FEDERAL-MOGUL BURSCHEID GMBH

[DE/DE]; Bürgermeister-schmidt-Strasse 17, 51399

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: 11/38, 3/10

C25D 3/04,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP2003/010425

(22) Internationales Anmeldedatum:

18. September 2003 (18.09.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 55 853.1

29. November 2002 (29.11.2002) DE (72) Erfinder; und

Burscheid (DE).

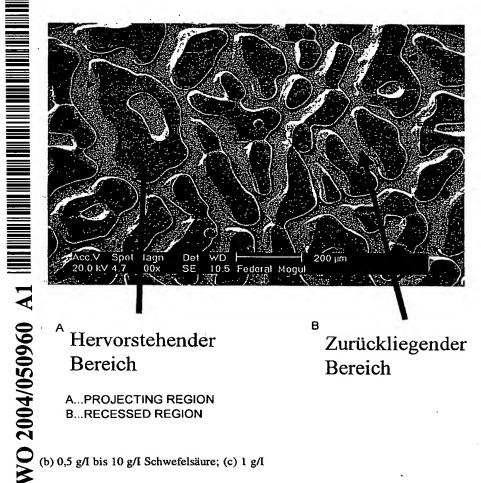
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LINDE, Rudolf [DE/DE]; Hasenpfad 51, 42929 Wermelskirchen (DE). DÜRDOTH, Stefan [DE/DE]; Dierath 20, 51399 Burscheid (DE).

(74) Anwälte: STÖRLE, Christian usw.; Geyer, Fehners & Partner, Perhamerstrasse 31, 80687 München (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PRODUCTION OF STRUCTURED HARD CHROME LAYERS

(54) Bezeichnung: HERSTELLUNG STRUKTURIERTER HARTCHROMSCHICHTEN



Hervorstehender Bereich

Bereich

A...PROJECTING REGION **B...RECESSED REGION**

(b) 0,5 g/I bis 10 g/I Schwefelsäure; (c) 1 g/I

Zurückliegender

(57) Abstract: A method for the production of a structured hard chrome layer is disclosed, whereby chrome is deposited on a workpiece from an electrolyte comprising: (a) Cr(VI) compounds in an amount corresponding to 50 g/l to 600 g/l of chromic acid anhydride, (b) 0,5 g/l to 10 g/l of sulphuric acid, (c) 1 g/l to 20 g/l of aliphatic sulphonic acids with 1 to 6 carbon atoms and (d) 10 g/l to 200 g/l of at least one compound forming a dense cathode film, selected from ammonium, alkali and earth alkali molybdates, ammonium, alkali and earth alkali vanadates and A ammonium, alkali and earth alkali zirconates. The invention further relates to a structured hard chrome layer, obtained by said method and an electrolyte for carrying out the method.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur Herstellung einer strukturierten Hartchromschicht beschrieben, wobei . Chrom aus einem Elektrolyt auf ein Werkstück abgeschieden wird, der enthält: (a) Cr(VI)-Verbindung in einer Menge, die 50 g/I bis 600 g/I Chromsäureanhydrid entsprechen;

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

BEST AVAILABLE COPY

WO 2004/050960 A1



- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,

TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

10

15

25

30

35

Federal-Mogul Burscheid GmbH Bürgermeister-Schmidt-Straße 17 D-51399 Burscheid

Herstellung strukturierter Hartchromschichten

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung einer strukturierten 20 Hartchromschicht auf einem Werkstück, dadurch erhältliche strukturierte Hartchromschichten und einen Elektrolyt zur Durchführung des Verfahrens.

Elektrochemisch bzw. galvanisch abgeschiedene Chromschichten gelten seit vielen Jahren als Stand der Technik bei funktionellen und dekorativen Einsatzgebieten und Anwendungen zur Beschichtung von elektrisch leitenden und nicht leitenden Werkstücken.

Der Einsatz strukturierter elektrochemisch erzeugter Hartchromschichten hat in den vergangenen Jahren und gerade in letzter Zeit zunehmend an Bedeutung gewonnen. Vor allem der Einsatz funktioneller Strukturen zeigt einen starken Aufwärtstrend. Typische Anwendungen finden sich bei der Beschichtung von Druckwalzen zu deren besseren Benetzung mit Farbe, bei Walzen zum Prägen von Blechen, zur Verbesserung des Tiefziehprozesses für die Autoindustrie und auch beim Lagern zum Schutz vor Verschleiß und der Verminderung von Reibung.

- Die nach dem Stand der Technik eingesetzten strukturierten Schichten weisen jedoch alle einen ausgeprägten kugeligen Schichtaufbau auf. Die Größe der Kugelformen schwankt zwischen weniger als 1 μm und mehreren μm. Der Bedeckungsgrad bzw. die Dichte des sphärischen Schichtaufbaus ist je nach Verfahren mehr oder weniger variierbar.
- So werden strukturierte Chromschichten nach DE 33 077 48 A1, DE 42 11 881 A1 und DE 43 34 122 A1 durch Variation der elektrischen Gleichströme erzeugt, wobei der Aufbau der Strukturen durch Variation von Stromrampen- und Stromimpulshöhen beeinflußt werden.

Nach DE 44 32 512 A1 werden ebenfalls sphärische Strukturen erzeugt. Hier werden deren Wachstum jedoch über die Zugabe von Salzen der Elemente Selen oder Tellur zum Verchromungselektrolyten ermöglicht.

Nach DE 19828545 C1 hat die Zugabe von 2-Hydroxyethansulfonationen zum Elektrolyten in Kombination mit dessen Temperaturvariation und der Variation des angelegten elektrischen Gleichstroms ebenfalls kugelige Strukturen zur Folge.

Alle diese aufgeführten strukturierten Chrombeschichtungen besitzen jedoch die gleiche, mehr oder weniger stark ausgeprägte kugelige Charakteristik, die nicht für alle Anwendungen geeignet ist. Die Schichten sind zum Teil ungleichmäßig ausgebildet und der Prozeß zu deren Abscheidung unterliegt einigen nicht sicher zu kontrollierenden Mechanismen.

Aus der WO 02/38835 A1 ist ein Verfahren zur elektrolytischen Beschichtung von Werkstoffen bekannt, wobei eine Chromlegierung aus einem Elektrolyten abgeschieden wird, der wenigstens Chromsäure, Schwefelsäure, ein Isopolyanionen ausbildendes Metall, eine kurzkettige aliphatische Sulfonsäure, deren Salz und/oder deren Halogenderivat und Fluoride enthält. Die Ausbildung einer strukturierten Hartchromschicht wird in diesem Stand der Technik nicht erwähnt.

20

10

15

Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung einer strukturierten Hartchromschicht bereitzustellen, das nicht die Nachteile des Standes der Technik aufweist.

- 25 Erfindungsgemäß wird dies durch ein Verfahren zur Herstellung einer strukturierten Hartchromschicht erreicht, wobei Chrom aus einem Elektrolyt auf einem Werkstück abgeschieden wird, der enthält:
 - (a) Cr(VI)-Verbindung in einer Menge, die 50 g/l bis 600 g/l Chromsäureanhydrid entsprechen;
 - (b) 0,5 g/l bis 10 g/l Schwefelsäure;
 - (c) 1 g/l bis 20 g/l aliphatische Sulfonsäure mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und

35

30

(d) 10 g/l bis 200 g/l mindestens einer einen dichten Kathodenfilm ausbildende Verbindung ausgewählt unter Ammonium-, Alkali- und Erdalkalimolybdat, Ammonium-, Alkali- und Erdalkalizirkonat.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist bestens geeignet, um zur Herstellung strukturierter Hartchromschichten angewandt zu werden.

- Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird durch eine gezielte Beeinflussung des sich bei der elektrochemischen Abscheidung von Metallen bildenden Kathodenfilms eine strukturierte Hartchromschicht erhalten, wobei die Schicht näpfchenförmig und/oder labyrinthartig und/oder säulenförmig ausgebildet ist.
- Löst man Salze in Wasser, so dissoziieren sie in Kationen und Anionen. Diese dissoziierten lonen umgeben sich gleichzeitig mit einer Hydrathülle, d.h. es lagern sich Wassermoleküle (als Dipole) um die Kationen bzw. Anionen an. Während der Hydratation wird die Ladungszahl der lonen nicht verändert. Beginnt nun ein hydratisiertes Metallion unter Stromeinfluß zu wandern, so gerät es in der Nähe der Kathode in einen Grenzbereich zwischen Elektrolyt und Kathode.

Dieser sogenannte Kathodenfilm befindet sich unmittelbar auf der Oberfläche des zu beschichtenden Werkstücks, da das Werkstück elektrisch negativ geschaltet ist. In dieser Phasengrenze werden die im Elektrolyten anwesenden Metallionen durch Aufnahme von Elektronen, die von der Kathode vom elektrischen Strom angeboten werden, zunächst ausgerichtet. Unmittelbar auf der Werkstückoberfläche unter der Diffusionszone befindet sich

ausgerichtet. Unmittelbar auf der Werkstückoberfläche unter der Diffusionszone befindet sich eine elektrochemische Doppelschicht, auch "Helmholtzsche Doppelschicht" genannt. Sie ist eine Bezeichnung für die etwa einige Atom- oder Molekülschichten dicke elektrisch geladene Zone an der Grenzfläche Elektrolyt/Elektrode. Ihre Bildung ist von Ionen, Elektronen oder gerichteten Dipolmolekülen abhängig. Sie ist auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite negativ aufgeladen und verhält sich so wie ein Plattenkondensator mit extrem niedrigem Plattenabstand. Das so entstandene Metallatom befindet sich nun auf der Werkstückoberfläche. Sein Zustand ist aber noch nicht mit dem eines Atoms im Metallinneren vergleichbar. Erst wenn eine sogenannte Wachstumsstelle vorhanden ist, ordnen sich die entstandenen Atome in das

30

35

vorhanden Metallgitter ein.

15

20

25

Üblicherweise werden die Abscheidebedingungen der Elektrolyte, wie chemische Zusammensetzung, Temperatur, Hydrodynamik und elektrischer Strom, so gewählt, daß eine gleichmäßige Bedeckung des Grundwerkstoffs mit dem abzuscheidenden Metall erfolgt. Dies bedeutet, daß der Kathodenfilm durch diese Maßnahme so beeinflußt wird, daß seine Durchlässigkeit für die anwesenden Ionen so gleichmäßig wie möglich ist.

Das Element Chrom liegt in wäßriger Lösung, im Vergleich zu den meisten elektrochemisch abscheidbaren Elementen, als negativ geladenes Komplexion hauptsächlich als Hydrogendichromat in stark saurer Lösung vor.

5 Das Chrom besitzt in diesem Komplex die Oxidationsstufe 6. Daneben sind in Elektrolyten auch geringere Mengen an Chrom (III)-Verbindungen enthalten.

Elektrolysiert man eine solche wäßrige Lösung, so bildet sich auf der Kathode ein fester Film, der eine Chromabscheidung verhindert. Es entsteht lediglich Wasserstoff, der wegen seines kleinen Radius durch den festen Kathodenfilm hindurchtreten kann, nicht aber die großen Hydrogendichromationen. Erst durch den Zusatz von Fremdanionen, z.B. Sulfat und Chlorid, wird der Kathodenfilm für Chromionen durchlässig und es kommt über verschiedene Oxidationsstufen zur Abscheidung des Chroms (siehe "Chemie für die Galvanotechnik" Leutze Verlag, 2. Auflage, 1993).

15

20

25

30

35

10

Durch die Zugabe mindestens einer einen dichten Kathodenfilm ausbildenden Verbindungen zum Elektrolyt wird die Bildung des Kathodenfilms so gesteuert, daß dieser durchlässig für Chromionen wird, so daß sich zunächst eine sehr dichte Sperrschicht bildet, welche dann je nach angelegter elektrischer Beschichtungsstromdichte durchschlägt und den Metallaufbau unterschiedlicher Stärke bzw. Schichtdicke entstehen läßt. Auf diese Weise werden strukturierte Chromschichten, die näpfchenförmig und/oder labyrinthartig und/oder säulenförmig ausgebildet sind, erhalten.

Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren erhaltene Chromschicht weist eine hohe Verschleißund Korrosionsbeständigkeit. hervorragende Gleiteigenschaften und Freßbeständigkeit sowie auch ein ästhetisch günstiges Aussehen auf, das kaum von einer anderen Beschichtung erreicht wird. Durch die näpfchenförmig und/oder labyrinthartig und/oder säulenförmig strukturierte Hartchromschicht kann sie für viele funktionelle oder auch dekorative Anwendungen eingesetzt werden. So ist beispielsweise durch die spezielle Struktur der Schicht ein besseres Aufnahmevermögen von Flüssigkeiten gewährleistet. Ferner kann der Aufbau eines Gaspolsters ermöglicht sowie eine verbesserte Verankerungsmöglichkeit für dort einzulagernde Stoffe, z.B. Kunststoffe, Farbstoffe, Metalle, Keramiken, elektronische Bauelemente, körpereigenes Gewebe als Implantatbeschichtung, erreicht werden. Des weiteren ermöglicht diese spezielle Struktur durch ihre Oberflächentopographie gezielte optische Effekte, z.B. hohes Adsorptionsvermögen für Licht- und Wärmestrahlung beim Einsatz von Solarkollektoren und auch dekorative Anwendungen im Designbereich.

Unter dem Ausdruck "Elektrolyt" im Sinne der vorliegenden Erfindung werden wäßrige Lösungen verstanden, deren elektrische Leitfähigkeit durch elektrolytisch Dissoziation in Ionen zustande kommt. Demzufolge weist der Elektrolyt neben den Komponenten (a) bis (d) und gegebenenfalls weiter vorliegende Zusatzstoffe als Rest Wasser auf.

5

Die vorstehend angegebenen Mengen der Komponenten (a) bis (d) beziehen sich auf den Elektrolyt.

10

Als Komponente (a) wird vorzugsweise CrO₃ eingesetzt, das sich für die elektrolytische Abscheidung von Chrom als besonders günstig erwiesen hat.

Eine als Komponente (c) vorzugsweise eingesetzte aliphatische Sulfonsäure ist Methansulfonsäure. Diese hat sich als besonders günstig für die Ausbildung der strukturierten Hartchromschichten mit vorstehenden Eigenschaften erweisen.

15

Als Alkaliionen für die Komponente (d) können Li⁺, Na⁺ und K⁺ eingesetzt werden. Beispiele für Erdalkaliionen sind Mg²⁺ und Ca²⁺. In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Komponente (d) (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4 H₂O, das sich als besonders günstig für die Ausbildung der strukturierten Hartchromschicht mit vorstehenden Eigenschaften herausgestellt hat.

20 ,

25

Der vorstehend näher bezeichnete Elektrolyt ist in einer besonders bevorzugten Ausführungsform im wesentlichen frei von Fluoriden. Dabei werden als Fluoride sowohl einfache als komplexe Fluoride verstanden. Liegen im Elektrolyten Fluoride vor, so wird die Ausbildung der strukturierten Hartchromschicht gestört. Der Ausdruck "im wesentlichen keine Fluoride" bedeutet demzufolge, daß soviel Fluorid im Elektrolyten tolerabel ist, daß die Ausbildung der strukturierten Hartchromschicht nicht beeinflußt wird. Die Menge der Fluoride, die tolerabel sind, können vom Fachmann leicht ermittelt werden. Als günstig hat es sich erwiesen, wenn nicht mehr als 0,1 g/l im Elektrolyt vorliegt.

30

35

Der Elektrolyt kann weiterhin übliche Katalysatoren, die die Chromabscheidung unterstützen, wie SO₄²⁻ und/oder Cl⁻ enthalten. Diese können in üblichen Mengen im Elektrolyt vorliegen.

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren werden strukturierte Hartchromschichten, wie sie vorstehend näher beschrieben wurden, auf Werkstücken ausgebildet. Unter dem Ausdruck "Werkstück" werden dabei Gegenstände jeglicher Art verstanden, die mit einer strukturierten Chromschicht ausgestattet werden sollen. Dabei kann es sich um metallische oder nicht metallische Gegenstände handeln. Soll auf einen nicht metallischen Gegenstand eine

10

15

20

25

30

strukturierte Hartchromschicht ausgebildet werden, so wird dieser zunächst durch Aufbringen eines dünnen Metallfilms elektrisch leitend gemacht.

Zur Ausbildung der strukturierten Hartchromschicht auf dem Werkstück wird dieses kathodisch geschaltet und in den Elektrolyten eingetaucht. An das Werkstück wird ein Gleichstrom, beispielsweise ein pulsierender Gleichstrom mit einer Frequenz bis 1000 Hz, angelegt. Die Temperatur für die Abscheidung des Chroms kann 45°C bis 95°C, insbesondere etwa 55°C betragen. Die Zeitdauer der Abscheidung wird in Abhängigkeit von der gewünschten Dicke der strukturierten Hartchromschicht gewählt, wobei die Schicht um so dicker wird, je tänger die Abscheidung erfolgt.

In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird mit einer Stromdichte von 20 A/dm² bis 200 A/dm² gearbeitet. Dadurch werden besonders günstige Strukturen der Hartchromschicht erhalten. Je höher die Stromdichte gewählt wird, desto dichter werden die hervorstehenden Bereiche der strukturierten Hartchromschicht.

Die kathodische Stromausbeute bei der Herstellung der strukturierten Hartchromschicht gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren liegt bei 12% oder weniger. Ist die Stromausbeute höher, wird die gewünschte Strukturierung der Hartchromschicht nicht erhalten.

Auf das Werkstück können mehrere Schichten aufgebracht werden, wobei sich die vorstehend erwähnten strukturierten Hartchromschichten und Schichten, die aus herkömmlichen Elektrolyten gebildet werden, wechselweise aufeinander abgeschieden werden können. Beispielsweise kann auf ein Werkstück zunächst die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren erhältliche strukturierte Hartchromschicht und darauf eine Schicht ausgewählt unter einer herkömmlichen Chromschicht, Schwarzchromschicht, Kupfer-, Nickel- oder Zinnschicht aufgebracht werden. Ferner kann zunächst auf dem Werkstück eine herkömmliche Chrom-, Kupfer- und/oder Nickelschicht aufgebracht werden und darauf die vorstehend näher beschriebene Hartchromschicht abgeschieden werden.

Direkt auf die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren erhältliche Hartchromschicht können weitere, nicht chromhaltige Beschichtungen aufgebracht werden, wie Kupfer, Nickel, Zinn, Zink, Keramik, Kunststoff, Festschmiermittel, Farbstoffe.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist femer eine strukturierte Hartchromschicht, wie sie nach dem vorstehend näher beschriebenen erfindungsgemäßen Verfahren erhältlich ist.

Die strukturierten Hartchromschicht ist – im Gegensatz zu den Hartchromschichten aus dem Stand der Technik, die einen ausgeprägten kugeligen Schichtaufbau aufweisen - näpfchenförmig und/oder labyrinthartig und/oder säulenförmig ausgebildet. Die erfindungsgemäße strukturierte Hartchromschicht weist die im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren geschilderten Vorteile auf.

Die erfindungsgemäße strukturierte Hartchromschicht kann zur Beschichtung einer Vielzahl von Werkstücken eingesetzt werden, beispielsweise Kolbenringe, Zylinder, Kolben, Bolzen, Nockenwellen, Dichtungen, Verbundmaterialien, Ventile, Lager zum Schutz vor Verschleiß und zur Verminderung der Reibung, Druckzylinder zur besseren Benetzung mit Farben, Prägewalzen für bessere Tiefziehprozesse für die Automobilindustrie, in der Solartechnik, für dekorative Anwendungen, in der Medizintechnik, der Mikrotechnik und der Mikroelektronik.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ferner ein Elektrolyt, enthaltend

15

10

5

- (a) Cr(VI)-Verbindung in einer Menge, die 50 g/l bis 600 g/l Chromsäureanhydrid entsprechen;
- (b) 0,5 g/l bis 10 g/l Schwefelsäure;
- 20 (c) 1 g/l bis 20 g/l aliphatische Sulfonsäure mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, und
 - (d) 10 g/l bis 200 g/l mindestens einer einen dichten Kathodenfilm ausbildende Verbindung ausgewählt unter Ammonium-, Alkali- und Erdalkalimolybdat, Ammonium-, Alkali- und Erdalkalivanadat und Ammonium-, Alkali- und Erdalkalizirkonat

25

zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Dieser Elektrolyt kann insbesondere zur Herstellung der vorstehend näher beschriebenen strukturierten Hartchromschichten auf Werkstücken verwendet werden.

30

Die vorliegende Erfindung wird in den nachfolgenden Beispielen unter Bezugnahme auf die Figuren näher erläutert, ohne sie jedoch darauf einzuschränken.

Die Figuren 1 bis 8 zeigen Fotografien gemäß den Hartchromschichten aus den Beispielen 1 35 bis 8.

Beispiel 1:

Ein herkömmlicher Chromelektrolyt folgender Grundzusammensetzung wurde hergestellt

Chromsäureanhydrid CrO₃

250 g/l

Schwefelsäure

H₂SO₄

4 2.5 g/l

5 Ein Warenteil wird nach üblicher Vorbehaltung in den Elektrolyten eingebracht und bei 55°C mit 40 A/dm² für 30 min. beschichtet.

Das unter diesen Bedingungen beschichtete Warenteil weist nach der Behandlung eine herkömmliche glänzende gleichmäßig ausgebildete Chromschicht auf, vgl. Fig. 1.

Beispiel 2:

10

15

25

30

35

Dem Elektrolyten nach Beispiel 1 werden zusätzlich Ammoniummolybdat (NH₄)₆Mo₇O₂₄ · 4 H₂O 100 g/l und Methansulfonsäure 4 g/l zugesetzt. Ein Warenteil wird nach den unter Beispiel 1 beschriebenen Bedingungen beschichtet. Das so beschriebene Warenteil weist nach der Behandlung eine strukturierte Chromschicht auf. Diese Chromschicht weist auf den hervorstehenden Oberflächenbereichen (Traganteil) ein glänzendes Aussehen auf und in den Vertiefungen der Struktur ist braunfarbener Kathodenfilm bzw. Sperrschicht erhalten (Fig. 2).

Beispiel 3:

20 Ein Warenteil wird nach den Bedingungen aus Beispiel 2 beschichtet. Es wird jedoch statt mit einer Beschichtungsstromdichte von 40 A/dm² mit 20 A/dm² gearbeitet.

Das so beschichtete Warenteil weist nach der Behandlung eine strukturierte Chromschicht auf. Der Anteil der hervorstehenden, glänzenden Oberflächenbereiche (Traganteil) ist geringer und der Anteil der tiefen Bereiche ist größer im Vergleich zu der Strukturschicht aus Beispiel 2 (Fig. 3).

Beispiel 4:

Ein Warenteil wird nach den Bedingungen aus Beispiel 2 beschichtet. Es wird jedoch statt mit einer Beschichtungsstromdichte von 40 A/dm² mit 60 A/dm² gearbeitet.

Das so beschichtete Warenteil weist nach der Behandlung eine strukturierte Chromschicht auf. Der Anteil der hervorstehenden, glänzenden Oberflächenbereiche (Traganteil) ist größer und der Anteil der tiefen Bereiche ist geringer im Vergleich zu der Strukturschicht aus Beispiel 2 (Fig. 4).

Beispiel 5:

5

15

20

30

Ein Warenteil wird nach den Bedingungen aus Beispiel 2 beschichtet. Das so beschichtete Warenteil weist nach der Behandlung eine strukturierte Chromschicht auf. In einer herkömmlichen Chromelektrolyten aus Beispiel 1 wird nun auf dieser strukturierten Chromschicht mit Chrom bei 55°C und 50 A/dm² für 120 min. weiterbeschichtet. Das so beschichtete Warenteil weist eine erhebliche Vergrößerung der Strukturhöhe auf im Vergleich zu Beispiel 2 (Fig. 5).

Diese gradierte Schicht besitzt auf der Oberfläche metallurgische Eigenschaften wie 10 herkömmliches Chrom und ist zusätzlich strukturiert.

Der Vorteil dieses Schichtaufbaus ist darin begründet, daß die Profilhöhe der Strukturschicht in einem weiten Bereich variiert werden kann, was durch die ausschließliche Abscheidung nach den Beispielen 2-4 durch deren geringe Schichtwachstumsgeschwindigkeit begrenzt ist.

Beispiel 6:

Ein Warenteil wird nach den Bedingungen aus Beispiel 2 beschichtet. Das so beschichtete Warenteil weist nach der Behandlung eine strukturierte Chromschicht auf. In einem herkömmlichen Schwarzchromelektrolyten wird nun auf dieser strukturierten Chromschicht eine schwarze chromoxidhaltige Schicht abgeschieden.

Das so beschichtete Warenteil weist eine gleichmäßige, tiefschwarze Oberfläche mit sehr hohem Lichtberechungsindex auf (Fig. 6).

25 Beispiel 7:

Ein Warenteil wird nach den Bedingungen aus Beispiel 2 beschichtet. Das so beschichtete Warenteil weist nach der Behandlung eine strukturierte Chromschicht auf. In einem herkömmlichen Zinnelektrolyten wird nun auf dieser strukturierten Chromschicht eine Zinnschicht abgeschieden, in ausreichender Dicke, um die Vertiefungen der Strukturchromschicht mit Zinn aufzufüllen.

Das so beschichtete Warenteil besitzt eine Oberfläche welche bei hohem Verschleißwiderstand ebenfalls sehr gute Gleiteigenschaften besitzt (Fig. 7).

35 Beispiel 8:

Ein Warenteil wird nach den Bedingungen aus Beispiel 1 mit einer herkömmlichen Chromschicht beschichtet.



Anschließend wird mit den Bedingungen aus Beispiel 2 auf die Chromschicht aus Beispiel 1 eine strukturierte Chromschicht aufgebracht.

Die strukturierte Chromschicht stellt eine Einlaufschicht für die herkömmliche Chromschicht dar und führt je nach tribologischer Anwendung zu einer Verbesserung des Schichtsystems (Fig. 8).

10

15

40

Patentansprüche

- Verfahren zur Herstellung einer strukturierten Hartchromschicht, wobei Chrom aus einem Elektrolyt auf ein Werkstück abgeschieden wird, der enthält:
 - (a) Cr(VI)-Verbindung in einer Menge, die 50 g/l bis 600 g/l Chromsäureanhydrid entsprechen;
 - (b) 0,5 g/l bis 10 g/l Schwefelsäure;
- 20
 - (c) 1 g/l bis 20 g/l aliphatische Sulfonsäure mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, und
- (d) 10 g/l bis 200 g/l mindestens einer einen dichten Kathodenfilm ausbildende Verbindung ausgewählt unter Ammonium-, Alkali- und Erdalkalimolybdat, Ammonium-,
 Alkali- und Erdalkalivanadat und Ammonium-, Alkali- und Erdalkalizirkonat.
 - 2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Cr(VI)-Verbindung CrO₃ ist.
- 3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die aliphatische Sulfonsäure Methansulfonsäure ist.
 - 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die einen dichten Kathodenfilm ausbildende Verbindung (NH₄)₆Mo₇O₂₄ · 4 H₂O ist.
- 35 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Elektrolyt im wesentlichen keine Fluoride enthält.
 - 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei mit einer Stromdichte von 20 A/dm² bis 200 A/dm² gearbeitet wird.



- 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei mit einer kathodischen Stromausbeute von 12% oder weniger gearbeitet wird.
- 8. Strukturierte Hartchromschicht, erhältlich nach den Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7.
 - 9. Elektrolyt, enthaltend

- (a) Cr(VI)-Verbindung in einer Menge, die 50 g/l bis 600 g/l Chromsäureanhydrid entsprechen;
 - (b) 0,5 g/l bis 10 g/l Schwefelsäure;
 - (c) 1 g/l bis 20 g/l aliphatische Sulfonsäure mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, und
 - (d) 10 g/l bis 200 g/l mindestens einer einen dichten Kathodenfilm ausbildende Verbindung ausgewählt unter Ammonium-, Alkali- und Erdalkalimolybdat, Ammonium-, Alkali- und Erdalkalizirkonat
- 20 zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 7.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Relevant to claim No.

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 C25D3/04 C25D11/38 C25D3/10

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C25D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

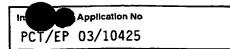
EPO-Internal, WPI Data, PAJ, CHEM ABS Data

Category . Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, or the rele	vani passages	Tielevan to damy to.
X	EP 1 205 582 A (ENTHONE OMI DEUTS) GMBH) 15 May 2002 (2002-05-15) cited in the application claims 1,2,5,8,12	CHLAND	1-6,8,9
Α	claim 15		7
X	US 5 196 108 A (WILMETH THOMAS S 23 March 1993 (1993-03-23)		1-6,8,9
Υ	column 4, line 24 -column 5, line abstract	18	7
X	DE 44 32 512 A (LPW CHEMIE GMBH) 14 March 1996 (1996-03-14) cited in the application		1-6,8,9
Y	claims 1-4,8,10 abstract	-/	7
X Fur	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
"A" docum consi "E" earlier filing "L" docum which citatik "O" docum other	ategories of cited documents: ment defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international date ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified) ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	 'T' later document published after the intor priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention 'X' document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the description of the cannot be considered to involve an indocument is combined with one or ments, such combination being obvicin the art. '&' document member of the same paten 	claimed invention It be considered to cournent is taken alone claimed invention It be considered to cournent is taken alone claimed invention iventive step when the iore other such docu- bus to a person skilled
Date of the	e actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	earch report
	29 January 2004	24/02/2004	
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Haering, C	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT



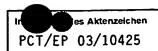
			PCT/EP 03/10425
DATABASE CA 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; HERBANSKY L ET AL.: "Electrodeposition of an antiabrasive layer on steel parts" Database accession no. 102:35412 XP002189917 abstract -& CS 214 553 B (HERBANSKY LADISLAV; KUBIK CTIRAD) 28 February 1984 (1984-02-28)	C.(Continua	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; HERBANSKY L ET AL.: "Electrodeposition of an antiabrasive layer on steel parts" Database accession no. 102:35412 XP002189917 abstract -& CS 214 553 B (HERBANSKY LADISLAV; KUBIK CTIRAD) 28 February 1984 (1984-02-28)	Category °		Relevant to claim No.
	1	CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; HERBANSKY L ET AL.: "Electrodeposition of an antiabrasive layer on steel parts" Database accession no. 102:35412 XP002189917 abstract -& CS 214 553 B (HERBANSKY LADISLAV;KUBIK CTIRAD) 28 February 1984 (1984-02-28)	1-9
1.1			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

mation on patent family members

I Applic	ation No
PCT/EP 03/	10425

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
EP 1205582	A	15-05-2002	EP BR CA CN WO EP US	1205582 0107473 2396946 1395629 0238835 1250472 2003121794	A A1 T A1 A1	15-05-2002 19-11-2002 16-05-2002 05-02-2003 16-05-2002 23-10-2002 03-07-2003
US 5196108	A	23-03-1993	NONE			
DE 4432512	Α	14-03-1996	DE	4432512	A1	14-03-1996
CS 214553	В	28-02-1984	cs	214553	B1	28-02-1984



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 C25D3/04 C25D11/38 C25D3/10

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 C25D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, CHEM ABS Data

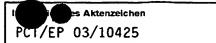
Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	EP 1 205 582 A (ENTHONE OMI DEUTSCHLAND GMBH) 15. Mai 2002 (2002-05-15) in der Anmeldung erwähnt	1-6,8,9
4	Ansprüche 1,2,5,8,12 Anspruch 15	7
X	US 5 196 108 A (WILMETH THOMAS S ET AL) 23. März 1993 (1993-03-23) Spalte 4, Zeile 24 -Spalte 5, Zeile 18	1-6,8,9
Y	Zusammenfassung	7
X	DE 44 32 512 A (LPW CHEMIE GMBH) 14. März 1996 (1996-03-14) in der Anmeldung erwähnt Ansprüche 1-4,8,10	1-6,8,9
Υ	Zusammenfassung	7

Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: A' Veröffentlichung, die den allgemelnen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist E' ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	 *T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist *X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
29. Januar 2004	24/02/2004
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Haering, C
L	<u> </u>

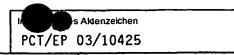
Siehe Anhang Patentfamilie

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT



		PCI/EP 03	7 10425
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	nden Teile	Betr. Anspruch Nr.
	DATABASE CA 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; HERBANSKY L ET AL.: "Electrodeposition of an antiabrasive layer on steel parts" Database accession no. 102:35412 XP002189917 Zusammenfassung -& CS 214 553 B (HERBANSKY LADISLAV;KUBIK CTIRAD) 28. Februar 1984 (1984-02-28) das ganze Dokument		1-9

INTERNATIONALER CHERCHENBERICHT Angaben zu Veröffentlichung zur selben Patentfamille gehören



LI 120330L	205582 A1 15-05-2002 07473 A 19-11-2002
CA 23 CN 13 WO 02 EP 12	396946 A1 16-05-2002 395629 T 05-02-2003 238835 A1 16-05-2002 250472 A1 23-10-2002 221794 A1 03-07-2003
US 5196108 A 23-03-1993 KEINE	
DE 4432512 A 14-03-1996 DE 44	332512 A1 14-03-1996
CS 214553 B 28-02-1984 CS 2	214553 B1 28-02-1984